防蝕工程 第十七卷第二期 第93~102頁 民國92年6月 Journal of Chinese Corrosion Engineering, Vol.17 No.2, PP. 93~102 (2003)

錯基非晶質合金在 300-500℃ 空氣下之氧化行爲研究

謝心心'、張瑋倫'、開物'*、聶台剛'、河村能人'

Oxidation Behavior of a Zr-Cu-Al-Ni Amorphous Alloys in Air at 300-500°C

H. H. Hsieh¹, W. L. Jang¹, W. Kai^{1,*}, T. G. Neih², and Y. Kawamura³

摘要

本研究探討錯基塊狀非晶質材料(Zr-30Cu-10Al-5Ni)在空氣環境中 300-500℃ 之氧化行為。研究結果顯示非晶質合金之腐蝕動力學在 300℃ 為直線型定律,350-425℃為遵守拋物線型定律且氧化速率隨溫度上升呈現相對下降的趨勢,但500℃呈現複雜而不規則氧化行為,此外,非晶質合金氧化後生成的氧化物在 300℃ 皆為正方晶之 ZrO₂,當溫度 T≥350℃ 時,以正方晶結構之 ZrO,為主,單斜晶之 ZrO,和 CuO 次之。

關鍵詞: 鋯基非晶質材料; 氧化行為; 腐蝕動力學; ZrO,; CuO。

ABSTRACT

The oxidation behavior of the Zr-based bulk amorphous alloy (BMG; Zr-30Cu-10Al-5Ni in at.%) was studied in dry air over the temperature range 300-500°C. The kinetics results indicated that the amorphous alloy oxidized linearly at 300°C, while the parabolic oxidation was observed at 350~425°C, and the oxidation behavior at 500°C was irregular and complicated. In general, the scales formed on the surface of the amorphous alloy were temperature-dependent, consisting of tetragonal-ZrO₂ at 300°C, and of mostly tetragonal-ZrO₂ as well as minor amounts of monoclinic-ZrO₂ and CuO at T \geq 350°C.

Keywords : Zr-based amorphous alloy; oxidation behavior; oxidation kinetics; ZrO₂; CuO.

1 國立台灣海洋大學材料工程研究所

3 熊本大學工學部

*連絡作者(TEL:02-2462-2192 Ext. 6403)

Institute of Materials Engineering, National Taiwan Ocean University, Keelung, 20224, Taiwan, Republic of China. 2 勞倫斯利物浦國家實驗室

Lawrence Livermore National Laboratory, L-350, P. O. Box, Livermore, CA 94551, USA

Department of Mechanical Engineering and Materials Science, Kumamoto University, Kumamoto 860-8555, Japan

一、前言

一般而言,塊狀非晶質合金(或稱為金屬玻璃) 較晶質化材料擁有較佳的物理、機械和化學特性。 近年來,有更多的塊狀非晶質材料被發展出來,其 中以鋯基和鐵基非晶質合金為主^[1-2],但它們的製程 上都必須以相當快速的冷卻速率才可獲得。根據文 獻^[3]指出一般鋯基非晶質合金須在 10³~10⁴ K/s之快 速冷卻下才可製成(視試片尺寸及合金成分而 異)。而添加多種合金元素的鋯基非晶質合金具有 大範圍的過冷區及很高的熱穩定性^[4]。此外,純鋯 本身的活性很高極易與氧發生反應^[5-7],生成 ZrO₂結 晶,而在鋯基非晶質合金中,ZrO₂的生成特性常因 不同元素的添加而有差異,它的氧化特性也因而複 雜,具有研究的必要性。

根據過去的研究中發現,以鋯元素為基材的塊 狀非晶質材料經氧化後會生成正方晶結構與單斜晶 結構的氧化鋯^[6],但卻無詳細說明那一種結構會優 先生成;此外Asami^[7]等人曾以Zr-Ni 塊狀非晶質合 金(Zr₆₅Ni₃₅)在527℃下進行氧化測試,發現該合金 生成的氧化層為正方晶與單斜晶的氧化鋯及氧化 鎳,而基材則因高溫氧化後產生晶質化的Zr₂Ni和 ZrNi 兩相。另一方面,Sun^[6]等人曾以非晶質 Zr₆₆Al₁₅Ni₂₅塊狀合金在310-410℃之乾氧氣中進行氧 化試驗,其結果發現生成微細立方晶之ZrO₂,且鎳 亦在氧化層中析出,同時,該合金的氧化層厚度會 隨著氧化溫度的升高而增加,且在基材中有 Zr₆₆Ni₁₅Al₁₅,晶質相之生成。

鑑於文獻上有關鋯基非晶質合金高溫氧化行為 之研究並不完整,各元素參與氧化的情形亦不相 同,故本研究選用一種鋯基非晶質材料 (Zr_{ss}Cu₃₀Al₁₀Ni_s),在 300-500℃ 的空氣環境下進行 高溫氧化測試,以了解鋯基非晶質合金的氧化機制 及各元素參與氧化反應的可能性。

二、實驗步驟

實驗用的鋯基非晶質塊材係由美國 Lawrence Livermore 國家實驗室提供之板狀材料(50×50×3 mm)。首先,將塊狀非晶質材料裁切成2×2×1.5 mm(重約50 mg)大小的長條狀試片,每一塊試片 先用 SiC 砂紙研磨到1200 號,再用 Al₂O₃ 粉抛光到 0.05 µ m。高溫氧化測試是在通空氣之熱重分析儀 (TGA,SETARAM TG92)中進行,TGA 之升溫速 率是 10 ℃/min,而溫度測試範圍是300-500℃。此 外,為求實驗準確,每次氧化測試之氧氣流率皆固 定在40 cm³/min,而氧化時間視溫度之高低而異; 測試後TGA分析儀再以每分鐘10 ℃/min 的降溫速 率降至室溫,待分析儀冷卻後,試片再由TGA 中取 出進行微結構分析。

氧化後試片先以 X-ray 繞射分析儀並配合逐層 研磨法分析表面及內部氧化物之組成,再以掃瞄式 電子顯微鏡(SEM)及電子微探儀(EPMA)分析 氧化物表面形貌及橫截面的元素分佈和定點成份分 析。

白金指標實驗是利用足踏式點焊機將直徑 30 μ m的白金線焊在試片的表 面,再經由上述之 TGA 進行氧化試驗,藉由觀察白金在氧化層的分佈位置 來判定非晶質合金之氧化反應機制。

三、實驗結果

1.TGA之動力學

鋯基非晶質合金在空氣中 300-500℃ 之重量變 化量與時間之關係,如圖 1 所示(圖 (a) 為增重vs. 時間;圖 (b) 為增重vs. (時間)¹²),除 300℃ 之 動力學趨於直線型定律外,350℃ 遵守單一式抛物 線型定律,而 400℃及 425℃ 呈現兩段式的抛物線 型定律,包括前一段的潛伏期及後一段的穩定期, 其中潛伏期的重量變化量非常特殊,先是不明顯的 增重,後又加速增重到某一時間(因溫度高低而 易),再緩慢下來而進入穩定期。但在500℃則呈現 不規則的動力學行為,顯示500℃的非晶質氧化行為 與其他各溫度不同。而各溫度的腐蝕速率值,彙整 如表1所示。由表1 得知, 錯基非晶質合金在350-425℃範圍內的氧化速率呈現不規則之增減趨勢,其 結果與文獻所載不同(3),可能的原因將在討論中說 明。

2.顯微組織分析

錯基非晶質合金氧化後的X-光繞射分析結果如 圖2所示,由圖中可知,錯基非晶質合金在 300℃時 只有正方晶之 ZrO₂生成,如圖2(a);但在400℃氧化 後的氧化物以正方晶 ZrO₂為主,而單斜晶之 ZrO₂ 及 CuO 次之,且單斜晶之 ZrO₂及 CuO 由氧化物表 面往內增加的趨勢;此外,且當研磨至氧化層最內 部與基材交接處時,發現基材仍保有非晶質之特 性,如圖 2(b),但在 425℃時,則有結晶化的相變 態發生,並生成 Zr,Cu 相,如圖 2(c) 所示。

錯基非晶質合金在空氣中氧化之SEM 觀察表面 型態如圖3所示,由圖上可知非晶質合金氧化後的表 面生成許多團狀的氧化物,EDX 分析表面氧化物以 ZrO₂為主,與 XRD 分析相似。而 500℃ 的試片表 面也有相似的情形發生,但其氧化物之顆粒尺寸大 小有逐漸增大的趨勢。

圖4為鋯基非晶直合金在不同溫度下氧化的橫截 面背向散射電子影像(BEI),由圖可知,非晶質合金 的氧化表層極為平整,且為均一的氧化層組織,但 在合金/氧化層界面交界處,氧化層多呈現非平面 (nonplanar)之分佈;而圖 5 是非晶質合金在 400℃ 氧化120小時的各元素分佈情形,其中鋯、銅與鎳是 均匀分佈在基材中,而銅和氧有明顯聚集在氧化層 的現象,足證氧化層中含有銅的氧化物。

為了解非晶質合金初始反應的行為, 鋯基非晶 質試片在 400℃, 4 小時短時間測試的 XRD 分析結 果如圖 6 所示,由圖可知,非晶質合金氧化初期僅 生成ZrO₂,且以正方晶之 ZrO₂為主,並含極少量的 單斜晶之 ZrO₂,且當氧化層因逐層研磨漸減少時, 基材仍保有非晶質之特性,由此可知非晶質在 400 ℃,4小時之氧化基材仍無結晶化之情形發生。

圖7是以鋯基非晶質材料在400℃之溫度下進行 120小時的腐蝕試驗的白金指標橫截面圖。由圖可 知,白金位置是位於氧化層的表面,顯示鋯基非晶 質合金的氧化機制係由氧離子內擴散來主導。

四、討論

由上述的結果得之, 鋯基非晶質合金在空氣 中300-500℃氧化後的特徵可歸納如下:(1) 300℃遵 守直線型定律;(2) 350℃呈現一段式抛物線型定 律,而400-425℃ 則為兩段式拋物線定律,但 500 ℃則無規律性可言;(3) 非晶質氧化後生成正方晶之 ZrO₂為主,當 T \geq 350℃時則有單斜晶之 ZrO₂及 CuO 生成,且氧化物與基材界面呈現非平面 (nonplanar)之界面;(4) 425℃以上的非晶質氧化 後,基材有結晶 Zr₂Cu 相生成,足證非晶質合金因 氧化而有結晶化的相變態趨勢;(5) 400℃短時間氧 化發現非晶質合金氧化後以正方晶之 ZrO₂為主要生 成物,另有微量單斜晶之 ZrO₂生成;(6) 白金指標 發現皆位於非晶質合金之表面,說明氧化機制係由 氧離子往內擴散來主導。

本研究主要探討鋯基塊狀非晶質合金 (Zr-30Cu-10Al-5Ni) 在空氣中 300-500℃ 之氧化特性,由結果 得知,此合金在 300℃ 呈現直線性的氧化動力學, 說明了氧離子與非晶質合金元素的氧化行為係由氣 氛/基材界面反應來主導,此種界面反應控制之機制 係因整個氧化反應的速率決定步驟並非陰、陽離子 擴散所致,反而是在氧氣/基材界面上的反應來控 制;由文獻⁸¹得知,當溫度較低或氧化膜很薄時, 氧化動力學易呈現界面反應控制之氧化行為,是以 300℃ 在本研究中即屬此種情形。另一方面,當溫 度達 350℃以上時,此時界面反應速率增快,可能 較陰、陽離子之擴散機制為快,因此,使得非晶質 合金在 350℃ 形成固態擴散控制的氧化反應,而呈 現單一式拋物線型定律。

當氧化溫度上升到 400℃ 時,呈現兩段式氧化 動力學行為,包括初始的一段潛伏期及後來一段穩 定期的動力學現象,而在潛伏期時,氧化增重先不 明顯,又加速增重到一段時間(因溫度不同而異) 再減緩下來,而進入緩慢增重的穩定期,因此,由 表1得知400℃及425℃的氧化速率(以穩定期來 計算) 反較 350℃ 為慢。此種高溫卻呈現較慢的氧 化速率行為,並不能視為一般動力學逆轉現象,因 由表 2 得知 350℃-500℃ 的氧化生成物均相同,但 其氧化動力學卻呈現一段式(350℃)、兩段式(400-425℃) 及不規則 (500℃) 之結果,因此,當生成物 相同卻呈現不同動力學行為時是無法說明動力學逆 轉的現象。另一方面,事實上由前面 XRD 分析結 果得知,非晶質合金在400℃,4 小時氧化後,並無 結晶相(Zr,Cu)的生成,但在高溫時則有利於非晶質 合金的晶質化現象,此時相變化亦有可能造成合金 氧化動力學的改變,雖然文獻上並無任何結果可以 佐證,但由實驗結果相信,425℃之動力學在氧化 初期可能由晶質化的結果而有一段潛伏期,即重量 變化量突然增大,且此時僅有正方晶及單斜晶相之 ZrO, 生成, 俟長時間氧化後才生成 CuO, 此時早已 進入穩定狀態的氧化階段,而呈抛物線型定律,即 此時氧化之機制實由氧離子內擴散(配合白金指標 之結果,如圖7所示)到基材來主導整個反應。

事實上,根據文獻^[8]指出,純 Zr 及部分 Zr 基 晶質合金的高溫氧化,多生成 ZrO₂氧化層,而文獻 ^[9]亦報導 ZrO₂為 N-type 半導體,其主要缺陷為氧離 子空孔(〔Vö〕)來主導,是以鋯基合金之氧化行為 係由氧離子的內擴散為主,因此可之,鋯基非晶質 合金在氧化機構上與純鋯晶質合金相同。

鋯基非晶質合金氧化後的氧化物因溫度高低而
 巽,由表 2 得知,在 300℃時,僅有正方晶生成,

而 350℃ 以上時,則有正方晶及單斜晶之 ZrO₂ 和 CuO 生成,其中正方晶之 ZrO₂ 含量在氧化層表面最 多,愈往氧化層內部而漸減,但單斜晶之 ZrO₂ 有漸 增之趨勢,此外,CuO 在氧化層中分佈較為均匀, 特別在合金基材與氧化層最內部之界面上最為明顯 (如圖 2 所示);另外,由短時間實驗得知,合金氧 化初期僅 生成 ZrO₂(正方晶為主,及少量單斜 晶),但長時間氧化後,則有 CuO 之生成,且單斜 晶之 ZrO₂含量也漸增,此時對照動力學行為可知, CuO 及單斜晶之 ZrO₂應於穩定期生成,且 CuO 之 生成顯然有助於減緩合金之氧化速度。

文獻上,Asami^{17]} 報導過 Zr₆₅Ni₃₅ 非晶質合金在 527K 空氣氧化行為,其結果亦發現氧化層中有正方 晶和單斜晶結構的 ZrO₂ 及部分 NiO,同時,氧化後 之基材也形成 Zr₂Ni 與 ZrNi 的晶質相,此說明非晶 質 Zr-Ni 二元合金氧化後亦有晶質化的相變態情形 發生,與本研究相似;惟本研究中的鎳含量不高(5 at.%),它的相對活性較低,故合金氧化時並未發 現任何氧化鎳生成,而基材中也無含鎳之晶質相產 生,反而是含量較高的銅生成 CuO 及 Zr₂Cu 結晶 相。

依據文獻研究得知^[10],ZrO₂ 共有立方、正方及 單斜三種可能的同質異構相,其中,1000-1200℃ 以下為單斜晶穩定,1300℃ 左右則為正方晶,而立 方晶需在高溫 1500℃ 以上才穩定,然而由 XRD 逐 層研磨發現,氧化溫度 300℃ 僅有正方晶生成, 350℃ 以上時正方晶與單斜晶都生成,且單斜晶之 含量逐漸由氧化層表面往內部增加,因此推測非晶 質合金氧化時,其氧化物的結晶相結構並不完全依 照文獻所載之方式生成,反而是在表面以正方晶為 主要生成相,其真正的原因並無文獻說明可知,亦 將是未來值得深入研究的課題。

此外,由銅氧化的文獻研究得知,銅在 T> 200 ℃氧化時,可依序生成 Cu/Cu₂O/CuO 之界面層,且 以 Cu₂O 為主要生成相,同時 Cu₂O 是位在 Cu 與 CuO 之界面中生成,然而對鋯基非晶質合金之氧化 結果,僅偵測到 CuO 並無 Cu₂O 之生成,推測可能 由於 Cu₂O 之生成速率太慢,且 CuO 之生成速率較快,以致在多相生成效應下,僅有 CuO 之生成¹¹¹。 同時,本研究之鋯基合金亦含有 10 at.% Al,而 XRD 分析亦無 Al₂O₃ 之生成,由此可知,合金中鋁 的含量亦低,以致其相對活性較低,不足以生成氧 化物。

五、結論

- : 銷基非晶質合金在空氣中氧化動力學行為因溫度 不同而有差異,在 300℃ 遵守直線性定律,350 ℃ 為單一抛物線定律,400-425℃ 為兩階段式抛 物線定律;而在 500℃ 時呈現不規則的趨勢。
- 350℃以上有正方晶及單斜晶之ZrO₂ 和少量CuO 生成,且單斜晶之含量由氧化層表面往內漸增。
- 3.
 结基非晶質合金在初始氧化反應生成的氧化物以 正方晶之ZrO₂為主,但當時間增長時,單斜晶之 ZrO₂和CuO亦伴隨生成。
- 4. 鋯基非晶質合金在 T> 425℃ 氧化後,基材產生晶 質化現象,並生成 Zr₂Cu。
- 白金指標實驗的白金位置是在氧化層表面,顯示 錯基非晶質合金的氧化機制係由氧離子內擴散來 主導。

六、致謝

本研究承國家科學委員會經費的補助 (NSC 90-2216-E-019-066),特此致謝。

七、參考文獻

- A. Inoue and T. Zhang, Mater. Trans., JIM 37 (1996) 185.
- 2. A. Inoue, N. Nishiyama, and H. M. Kimura, Mater.

Trans., JIM 38 (1997) 189.

- T. Zhang, A. Inoue, and T. Masumoto, Mater. Trans., JIM, 32 (1991) 1005.
- J. Eckert, N. Mattern, M. Zinkevitch, and Seidel, Mater. Trans., JIM, 39 (1998) 623.
- 5. A. Dhawan, K. Raetzke, F. Faupel, and S. K. Sharma, Bull. Mater. Sci., 24, 3 (2001) 281.
- X. Sun, S. Schneider, U. Geyer, W. L. Johnson, and M.-A. Nicolet, J. Mater. Res., 11, (1996) 2738.
- K. Asami, H. M. Kimura, K. Hashimoto, and T. Masumoto, Mater. Trans., JIM 36 (1995) 988.
- N. Birks and G. Meier, Introduction to High-Temperature Oxidation of Metals, Edward Arnold, Ltd., London, 1983.
- 9. D. L. Douglass, The Metallurgy of Zirconium, IAEA, Vienna, 1971.
- P. Kofstad, High Temperature Corrosion, Elsevier Applied Science, London & New York, 1988.
- B. Gleeson D. L. Douglass, and F. Gesmundo, Oxid. Met, 33 (1990) 425.

- 表1. 鋯基非晶質合金在 300-500℃ 乾空氣下的氧 化速率(單位:g²/cm⁴/sec)
- Table 1. Corrosion Rate Constants of the BMG alloy (unit: g²/cm⁴/sec).

腐蝕速率温度	Kp 值
300 °C	1.16×10 ⁻⁹ (g/cm ² /sec)(直線性定律)
350 °C	1.156×10 ⁻¹¹
400 °C	8.76×10 ⁻¹²
425 °C	3.65×10 ⁻¹²
500 °C	不規則

- 表2. 錯基非晶質合金在 300-500℃ 氧化後的生成 物差異表
- Table 2. Main oxides formed on the amorphous alloy oxidized at 300-500 °C.

溫度	主要生成物
300°C	$ZrO_{2(t)}(v. s.)$
350°C	$ZrO_{2(t)}(v. s.) ZrO_{2(m)}(w.)$
	CuO (v. w.)
400°C	$ZrO_{2(t)}(v. s.) ZrO_{2(m)}(s.)$
	CuO (v. w.)
425°C	$ZrO_{2(t)}(v. s.) ZrO_{2(m)}(w.)$
	CuO (s.)
500°C	$ZrO_{2(t)}(v. s.) ZrO_{2(m)}(s.)$
	CuO (w.)

註:t 表示正方晶相(tetragonal phase) m 表示單斜晶相(monoclinic phase) v.s. 表示非常強 s. 表示次強 w. 表示弱 v.w. 表示非常弱







(b) 350℃ 氧化480 小時, 400℃ 氧化120 小時, 425℃ 氧化96 小時, 500℃ 氧化50 小時

- 圖1. 鋯基塊狀非晶質合金在不同溫度下氧化的
 動力學曲線,(a)在300℃下氧化,(b)在350
 ℃-500℃下氧化
- Fig. 1. Oxidation kinetics of Zr-based amorphous alloy (a) at 300°C oxidized for 480 hr, (b) at 350°C to 500°C oxidized at various durations.



- 圖2. 鋯基塊狀非晶質經不同溫度氧化後之 XRD
 逐層研磨分析圖 (a) 300℃氧化 480 小時,
 (b) 400℃ 氧化 120 小時,
 (c) 425℃ 氧化 96
 小時
- Fig. 2. XRD analyses of the scales formed on BMG
 (a) at 300°C oxidized for 480 hr, (b) at 400°C oxidized for 120 hr, (c) at 425°C oxidized for 96 hr.



(a) 300℃氧化480 小時



(b) 400℃氧化120 小時



(c) 425℃氧化 96 小時^{2µm}



(d) 500℃氧化50 小時

- 圖3. 鋯基塊狀非晶質合金於不同溫度下氧化後 之表面型態
- Fig. 3. The surface morphology of the oxide scale formed on BMG.



(a)



(b) Zr-map



(c) Al-map



(d) Cu-map



(a) 350°C氧化216 小時



(b) 400℃氧化120 小時



(c) 425℃氧化96 小時

- 鋯基塊狀非晶質合金在不同溫度下氧化後 圖4. 之 BEI 橫截面
- Cross-sectional BEI micrographs of the BMG Fig. 4. alloy oxidized at various temperatures.



(e) Ni-map



(f) O-map

- 圖5.(a) 錯基非晶質合金在400℃ 氧化120 小時之
 BEI 橫截面圖,(b)-(f) 為相關元素之 X 光元素分佈圖
- Fig. 5. (a) Cross-sectional micrograph of the scales and X-ray maps of (b) Zr, (c) Al, (d) Cu, (e) Ni, (f) O for the BMG alloy oxidized at 400°C for 120 hr.



- 圖6. 錯基非晶質400℃,4小時短時間氧化之 XRD分析圖
- Fig. 6. XRD analyses of BMG oxidized at 400°C for 4hr.



- 圖7. 錯基非晶質材料在 400℃ 氧化 120 小時之 白金指標橫截面圖
- Fig. 7. BEI micrograph illustrating the position of Ptmarker formed on BMG after oxidized at 400 °C for 120 hr.